


## 集束イオンビーム加工観察装置（国補）

メーカー名	日本電子(株)		
型式	JIB-4000		
機能（用途）	<p>本装置は、細く絞ったガリウム（Ga）イオンビームを試料に照射し、周辺の原子を弾き飛ばすことで、ナノメートルオーダーの微細加工を行い、断面構造を観察するものです。主な用途は、極めて高精度な狙い精度による断面加工であり、作製した断面はステージを傾斜させて観察可能です。</p> <p>また、加工した断面を SEM-EDS、EBSD 等の他の装置で分析したり、TEM（透過電子顕微鏡）観察用に厚さ 100nm 以下の薄片を作製するなど、各種微小領域分析用の試料作製に威力を発揮します。</p>		
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>○イオン源：ガリウム液体金属</li> <li>○加速電圧：1～30kV</li> <li>○最大電流：60nA</li> <li>○像分解能：5nm（30kV）</li> <li>○デポジション：カーボン、タングステン</li> </ul>		
外観			
利用形態	依頼試験	共同・受託研究	
担当部門等	材料技術部門	金属材料部	TEL 026-226-2012